

## 塗布技術研究会 第 69 回関東定例会

### 題目

塗布乾燥プロセスへの新たな赤外線応用技術

### 発表者

近藤 良夫 氏(日本ガイシ株式会社)

### 要旨

近年、各種製造工程において「乾燥」の重要性がクローズアップされている。現状主流である熱風乾燥方式は、汎用性が高くメリットも多く有しているが、効率化の限界に直面しているケースも散見される。弊社では、塗布膜の吸収特性に適合した選択波長赤外線に着目し、それによる乾燥時間削減や製品ダメージレス等の可能性について長期間検討してきた。塗布膜中の諸分子と赤外光との相互作用を含め、新たなプロセスの構築に向けてできる限り最新の実験結果を踏まえつつ考察を試みる。